

OD ~ 3Dナノマテリアルの内部構造を 探る分光テラヘルツイメージング

アニス・ラーマン

テラヘルツ時間領域走査技術は、カメラレス、格子分解能、層間のイメージ ング、そして単純及び複雑なナノマテリアルの内部構造の識別を可能にする。

ナノテクノロジーの進歩する中、フォ トニクスのコミュニティは現在、極小か つ多様な構造パラメータを持つナノスケ ール材料の測定と識別を担っている。

ナノスケールにおいて、0次元(0D) 構造とは、例えば量子ドットのような、 10nmかそれ以下のオーダーの真にナノ スケールの次元を持つものたちのこと である⁽¹⁾。これらの0D材料は多次元 の分子ネットワークを構成することはな いが、ド・ブロイ波長より小さなサイズ のナノ次元に独立して存在している。

分子ネットワークを形成し、直径が 100nm未満のままで変化せず、一方向 に長さを拡張するナノワイヤーやナノ ロッドといったナノマテリアルは、1次



現代のナノフォトニックプロセスは、 これらのエキゾチックなナノマテリア ルの合成や生産を促進した一方で、こ れらのナノスケール及びサブナノスケ



光ファイバケーブル

図1 テラヘルツナノスキャナのセットアップ では、反射モードと透過モードの両方の測定 が可能である(a)。ナノスキャナが選択され た2Dまたは3Dの領域上でサンプルをスキ ャンする間、サンプルは静止した状態である。 ここではイメージングの準備のため、光学ウ エハをテラヘルツナノスキャナにマウントし ている(b)。





ールの材料を測定し、適切に特性評価 するための機器には、新たな課題が提 起される。

米アプライド・リサーチ&フォトニク ス社(Applied Research & Photonics: ARP)のテラヘルツ時間領域イメージ ャ「TNS3DI」は、上記の0Dから3D までの材料の分析及び定量化が可能で ある。従来の研究によると、表面トポ グラフィやテクスチャ、ステップ高さな どの表面特性の測定が、幅広い表面及 び材料にわたって実証されている⁽²⁾。 しかし0D~3D材料の計測には、そ れらのサイズパラメータ及びサイズ分 布を定量化するだけでなく、あるナノ 材料と他のナノ材料の相互作用を定量 化することも含まれる。

0次元の量子ドット

量子ドット(Quantum Dot:QD)は、 電子と正孔をド・ブロイ波長内に閉じ 込めたナノ結晶である。それゆえに、 これらのナノ結晶は、わずかナノメー トルのサイズである。このスケールで は、電子は小さな空間領域に閉じ込め られ、単一の原子に似た、離散的なエ ネルギー準位を取る。このため、QD は「人工原子」とも呼ばれる。

QDは、最も一般的には分子線エピ タキシー(Molecular Beam Epitaxy: MBE)のようなエピタキシャル技術、ま たはコロイド化学によって製造される。 通常は、QDの画像は原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope: AFM)を
使用して取得される。走査型電子顕微
鏡(Scanning Electron Microscope:
SEM)は、QDがスライドガラスなどの基板上に堆積されている場合にも使
用できる。

その代わりにARP社のTNS3DIの カメラレスイメージング技術は、テラ ヘルツ放射を使用して、0Dから3Dま でのナノ材料の特性を明らかにする。 テラヘルツのセットアップは、3D空間 で物体をデジタル化するナノスキャナ で構成されている(図1)。

写真フィルムや電荷結合素子(CCD) などの記録メディア上に結像するレン ズによって形成される(造られる)画像 の解像度は、アッベの回折限界(Abbe Diffraction Limit: ADL)によって決定 されることがよく知られている。すな わち ADLでは、イメージングに使用 される光の半分の波長が解像度の限界 値となる。幸いなことに、テラヘルツ マルチスペクトル再構成イメージング は、ADLを克服し、より高い解像度 の画像を得ることが可能である⁽³⁾。

ほとんどの材料はテラヘルツ放射に 対して透過性があるため、ARP社のナ ノスキャナは、非破壊かつ非接触で表 面下の特徴を調べ、可視化できる。ま たハードウエアとソフトウエアを組み合 わせることで、ユーザーがピクセルサイ ズ(3Dであればボクセルサイズ)を自由 に定義することが可能である。一方デ ジタルカメラは、サンプルから処理さ れた信号を、固定されたピクセルサイ ズに表示及び記録するだけである。

カメラでは、物体はCCDまたは焦 点面に像を結び、組み込みプロセッサ が画面に画像を表示し、画像データを ファイルに保存する。対照的にテラへ ルツ技術は、ナノスキャナ及び画像の 生成と処理に適したコンピュータアル



図2 テラヘルツナノスキャナにより示された、シリコンウエハ上にスピンさせたQDの低解像度 画像(a)。ソフトウエアで3D画像またはデータキューブに変換したQD(b)。

ゴリズムを使用することで、CCDとレ ンズシステムが不要になる。

ここで、画像化される物体は、3D イメージングの場合は3つの直交軸に 沿ってスキャン(デジタル化)され、表 面イメージングの場合は平面上でデジ タル化される。デジタル化された反射 信号(または伝達信号に等しい)を含む 行列がファイルに記録され、適切なア ルゴリズムによって処理される。金属 ニッケルの格子定数の実験値0.353nm は、文献の値と同じであり、これが、 テラヘルツイメージング技術の正当性 を立証する。

シリコンウエハ上でスピンする複数 の0D QDの場合、ナノスキャナのイ メージングデータはx-y平面における QDの物理特性を示し、そして変換さ れた3Dデータキューブは個別のドット を明確に描く(図2)。強度マトリック スから、個々のドットの詳細な画像が 生成され、寸法情報を取得することが できる(図3)。

1次元構造の特性評価

1Dナノ材料の例としては、ナノワ イヤーやカーボンナノチューブが挙げ られる。それらの長さは幅(直径)に比 べてはるかに大きいため1D構造とみ なされる。カーボンナノチューブ (CNT)は円筒形のナノ構造であり、単 層及び多層カーボンナノチューブ(SW



図3 QDのフィールドにおける単一のQDのグラフ分析(a)から、直径が約8nmであることがわかる(b)。



図4 時間領域データのフーリエ変換により、 MWCNTの広帯域テラヘルツ吸収スペクトル が明らかになる。

CNT 及び MWCNT) に分類される。

TNS3DIを使用したテラヘルツ分析 は、電子工学や光学の特別なアプリケ ーションに役立つ独自の特性を備えて おり、さまざまな特性を評価すること ができる。内蔵のテラヘルツ時間領域 分光計を使用すれば、スペクトル分析 と、ディープレベル(深準位)分光法の 両方を実行できる。これにより、ユー ザーが指定したさまざまなサンプルの 深さにおいてスペクトルを収集できる。

TNS3DIは、特許取得済みのデンド リマー双極子励起(Dendrimer Dipole Excitation:DDE)のメカニズムにより 動作する、ARP社独自のテラヘルツ 源を使用したポンププローブ技術を実 装している⁽⁴⁾。テラヘルツ時間領域信 号を数ピコ秒にわたって収集すると、 インターフェログラムと呼ばれる信号 が生成される。インターフェログラム をフーリエ変換すると、サンプルの吸 収スペクトルが得られる(図4)。CNT サンプルのスペクトルの顕著な吸収ピーク は、1.72、4.29、6.61、13.70、15.59THz で観察される。スペクトルデータは0.1 ~ 30THzで収集されたが、ここでは見や すいよう20THzまでの範囲を示して いる。

デジタル顕微鏡やカメラなどのCCD イメージングデバイスは通常、良好な 解像度を備えているが、特に高い解像 度を得ることは難しく、また取得でき るのは表面の詳細のみである。また透 過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscopy:TEM)は高い解像度 を持つが、サンプルの準備に非常に手 間が掛かる、完全に破壊的な手法であ る。また小さい形状の場合にのみ使用 でき、3D像は取得できない。集束イ オンビームやX線回折(X-Ray Diffractive:XRD)のイメージングも破壊 的な手法である。

対照的にTNS3DIのテラヘルツイメ ージングは、ハードウエアとソフトウエ アの組み合わせによってピクセルサイ ズ(3Dではボクセルサイズ)を定義する ことができ、MWCNTのような複雑な



図5 MWCNTの一部分の3D画像は、アニールされたCNTの3D構造を明らかにする(a)。 単一のCNTの幅は円(b)で示されている。

構造体の特性を明らかにする。例えば、 MWCNTの一部分の典型的な3Dイメ ージは2 μ m×1 μ mの領域内の材料の さまざまな束を示し、単一のCNTの幅 を明らかにする(図5)。サイズ分析に より、CNTの平均直径は約48nmであ ることがわかる(図6)。さらに分析す ると、長さは約1200nm(1.2 μ m)であ った。この値は、TEMや電子回析、 及びラマンによる測定と比べてそん色 がない⁽⁵⁾。

2次元のグラフェン

理論的には、グラフェンは炭素原子 の単一層、つまり2Dナノ材料である と考えられている。グラフェンは主に グラファイトからはく離される。つま り、炭素原子の同素体は同じ原子を持 っているが、異なる配置が、物質に異 なる特性を与える。しかし実際には、 グラフェンはカーボンシートを何層か 持っているはく離層である。

ARP社では、テラヘルツマルチスペ クトルコンピューティングイメージン グにより、はく離層のグラフェン層(つ まりグラフェンのシート数)を直接測定 できる。また、はく離した単層の厚さ も測定できる。高品質のグラフェンは、 はく離層が10層未満で、層(シート) の厚さは1nm未満であることが求めら れる。酸化グラフェン(GO)はく離層 のシートの数はより多く、各シートの 厚さも大きくなる。

与えられたはく離層の3D画像が生 成されると、いくつかの有用なパラメ ータを抽出することができる。層の数 とその厚さに加え、高速フーリエ変換 (Fast-Fourier Transform:FFT)回折 パターンを生成し、結晶学的情報を記 述することもできる。この体積イメー ジングのデータは、層ごとの厚さ測定 を可能にするだけでなく、FFT回折パ





図6 MWCNTの画像を用いたサイズ分析 によって、CNTの平均直径は48.54nm(エ ッジ間)であることが明らかになった。

図7 それぞれ1µm³の4つのサンプルの高解像度3D画像。材料のニッケルに富む領域は、格子ひずみを引き起こす、埋め込まれたアルミナのナノ粒子を示す。

ターンを取得するのにも使用できる。

3次元ナノ材料

最近「科学における新規研究(Novel Research in Sciences:NRS)」内でわ れわれが発表した論文では、低エネル ギー核反応(LENR)実験として知られ るものであるが、金属及び絶縁体の層 を含むアルミナ棒サンプルにおけるニ ッケル格子の膨張についての研究を行 った⁽⁶⁾。サンプルは米ブリルアンエナ ジー社(Brillouin Energy)から入手し たもので、実験条件下において、サン プルは入力に対して過剰な出力エネル ギーを生成することがはっきりと示さ れた。

しかしながら、われわれは、LENR プロセスと考えられていたものよりも 高い出力エネルギーについて、異なる 説明ができることを見つけた。実験で 観察された、より高いエネルギーの生 成効果は、LENRの核変換とは対照的 な「格子駆動現象」である可能性が高 かった。

われわれは、「時間結晶様非平衡」 プロセスがエネルギーバランスを保た せていると仮定し、*in situ*及び*ex situ* において系統的な研究を行った。時間 結晶―新しい概念―は、空間だけでな く時間においても一定の間隔でパター ンが繰り返される物質の状態である。 それらは、時間対称性が自発的に破ら れるシステムだ。2012年に提案された 時間結晶は非平衡物質の一種であり、 決して熱平衡に到達することはない。

われわれは、テラヘルツ時間領域技 術を使用し、ガラス転移点付近で固体 よりもむしろ流体に近い、ニッケル結 晶の加熱サンプルを分析した(図7)。 高周波電界によって加えられた熱エネ ルギーは、流体に近いニッケル格子を 振動させ、非輻射遷移を引き起こし、 さらに高い熱エネルギーを作り出す。 電子顕微鏡を使う代わりにテラヘルツ 技術は格子イメージングにアッベ回析 限界を超えたテラヘルツ波を使って突 破口を開く。実験は、LENRが実際に は存在せず、むしろ時間結晶のような 非平衡効果が、エネルギーバランスを 制御していることを証明している。こ れこそが、LENR現象と考えられてい たものである。

ARP社のテラヘルツナノスキャナ は、CCD レスイメージングの新たな幕 開けをもたらす。ナノマテリアルの特 性評価技術は光学フィルムからCCD、 そしてついにはナノスキャナベース技 術へと進歩する。この新しい手法が、 産学のさまざまな問題の解決に役立つ ことを期待する。

参考文献

- (1) A. Rahman et al., J. Biosens. Bioelectron., 7, 3, 1-8 (2016); doi:10.4172/2155-6210.1000221.
- (2) A. Rahman, "Application of TNS3DI as a Surface Metrology Tool," doi:10.13140/ rg.2.2.30786.73921 (2020).
- (3) A. Rahman and A. K. Rahman, IEEE Trans. Semicond. Manuf., 32, 1, 7–13 (Feb. 2019); doi:10.110 9/ TSM.2018.2865167.
- (4) A. Rahman, A. K. Rahman, and D. A. Tomalia, Nanoscale Horiz., 2, 127–134 (Mar. 20, 2017); doi:10.1039/ c7nh00010c.
- (5) W. Ghann et al., J. Nanomed. Nanotechnol., 10, 4, 535 (2019); d oi:10.35248/2157-7439.19.10.535.
- (6) A. Rahman et al., Nov. Res. Sci. 2, 4, NRS.000545.2019 (2019); doi:10.31031/nrs.2019.2.000545.

著者紹介

アニス・ラーマン(Anis Rahman)は、米アプ ライド・リサーチ&フォトニクス社(Applied Research & Photonics: ARP)の社長兼最高 技術責任者。e-mail: a.rahman@arphotonic. net URL: http://arphotonics.net